

第十七讲 p-n结

10月11, 2002

内容:

1. 理想的p-n结在平衡时
2. 理想的p-n结在非平衡时

阅读作业

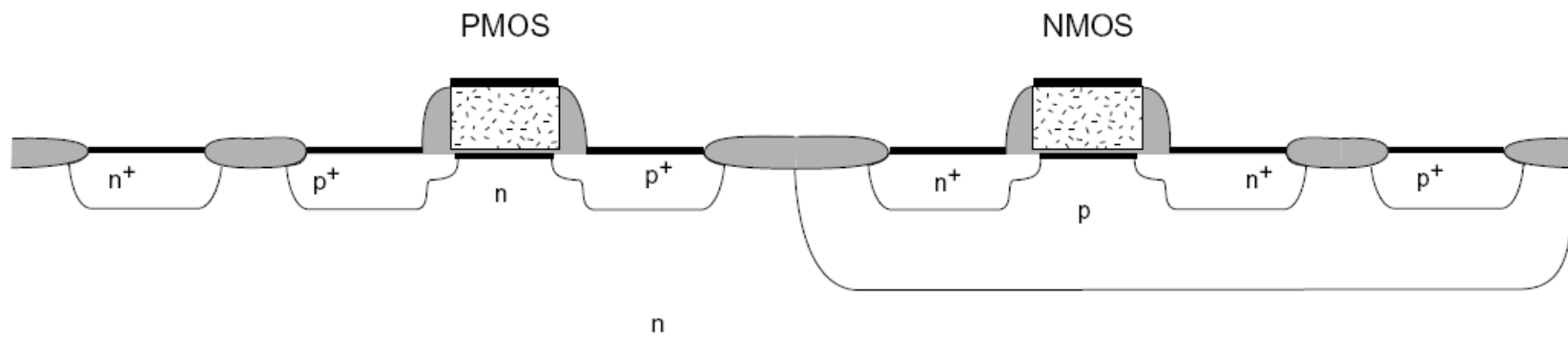
del Alamo Ch. 7, §§7.1 (7.2.1-7.2.3)

主要问题

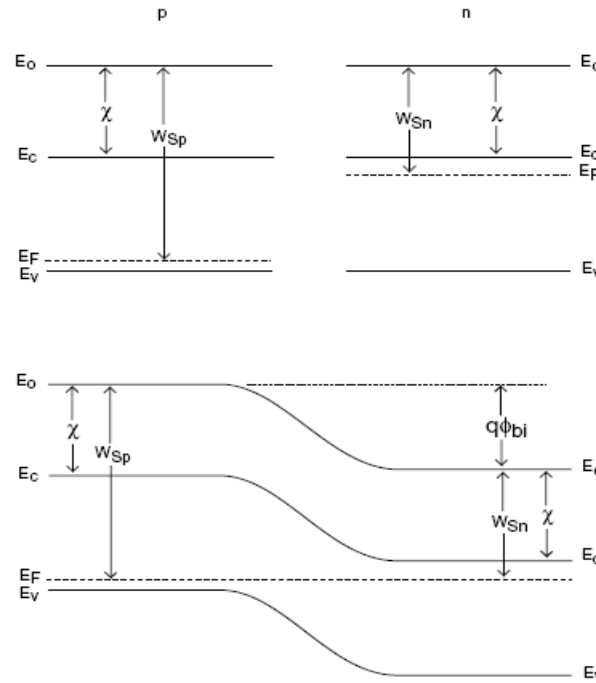
- 如果一个n型区和一个p型区紧密接触会发生什么？
- 如果在一个p-n结上加一个偏压，静电特性会有什么变化？
- 在偏压下一个p-n结电流的主要物理机制是什么？
- 成为p-n结整流行为的基础是什么？

动机: p-n无处不在!

例子: CMOS



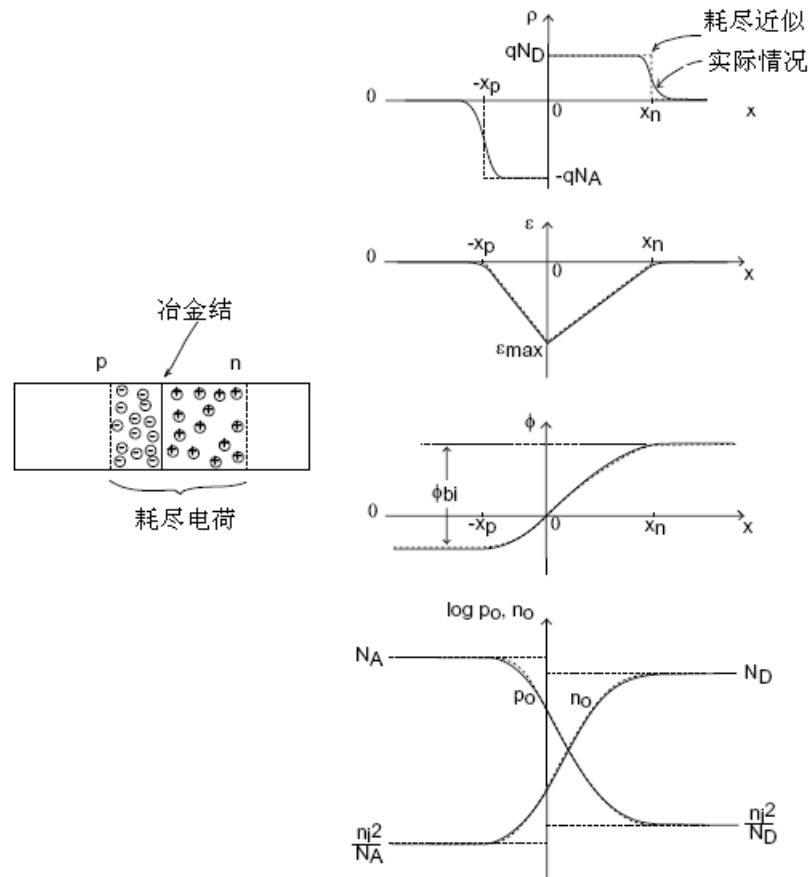
1. 理想的p-n结在平衡时



$$q\phi_{bi} = W_{Sp} - W_{Sn} = (E_C - E_F)|_{x=0} - (E_C - E_F)|_{x \neq 0} = kT \ln \frac{n_0(x \neq 0)}{n_0(x=0)}$$

那么:

$$\phi_{bi} = kT \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$



做耗尽近似:

□ 在体电荷密度: $\rho(x); 0$ 在 $p\text{-QNR}: x < -x_p$ 时

$$\rho(x); -qN_A \quad \text{在 } SCR: -x_p < x < 0 \text{ 时}$$

$$\rho(x); -qN_D \quad \text{在 } SCR: 0 < x < x_n \text{ 时}$$

$$\rho(x); 0 \quad \text{在 } n\text{-QNR}: x_n < x \text{ 时}$$

□ 电场: $\varepsilon(x); 0$ 在 $p\text{-QNR}: x < -x_p$ 时

$$\varepsilon(x); -\frac{qN_A}{2}(x + x_p) \quad \text{在 } SCR: -x_p < x < 0 \text{ 时}$$

$$\varepsilon(x); \frac{qN_D}{2}(x - x_n) \quad \text{在 } SCR: 0 < x < x_n \text{ 时}$$

$$\varepsilon(x); 0 \quad \text{在 } n\text{-QNR}: x_n < x \text{ 时}$$

□ 静电势 [选择 $\phi(x=0) = 0$]: $\phi(x); -\frac{qN_A x_p^2}{2}$ 在 $p\text{-QNR}: x < -x_p$ 时

$$\phi(x); -\frac{qN_A}{2}(x^2 + 2x_p x) \quad \text{在 } SCR: -x_p < x < 0 \text{ 时}$$

$$\phi(x); -\frac{qN_D}{2}(x^2 - 2x_n x) \quad \text{在 } SCR: 0 < x < x_n \text{ 时}$$

$$\phi(x); \frac{qN_D x_n^2}{2} \quad \text{在n-QNR: } x_n < x \text{ 时}$$

两个未知数: x_n 和 x_p

- 要求总的电荷保持电中性:

$$qN_A x_p = qN_D x_n$$

- 这个结构的电势差为 ϕ_{bi} :

$$\phi(x_n) - \phi(x_p) = \frac{qN_D x_n^2}{2} - \frac{qN_A x_p^2}{2} = \phi_{bi}$$

解出 x_n 和 x_p :

$$x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon N_A \phi_{bi}}{qN_D(N_D + N_A)}} \quad x_p = \sqrt{\frac{2\epsilon N_D \phi_{bi}}{qN_A(N_D + N_A)}}$$

总的SCR宽度:

$$x_{SCR} = \sqrt{\frac{2\epsilon(N_D + N_A)\phi_{bi}}{qN_A N_D}}$$

最大电场:

$$|\mathcal{E}_{max}| = \sqrt{\frac{2qN_A N_D \phi_{bi}}{\epsilon(N_D + N_A)}}$$

- 对称的结: $N_A = N_D$:

$$x_p = x_n$$

$$|\phi(-x_p)| = \phi(x_n)$$

- 非对称的结: 也就是 $N_A > N_D$

$$x_p < x_n$$

$$|\phi(-x_p)| < \phi(x_n)$$

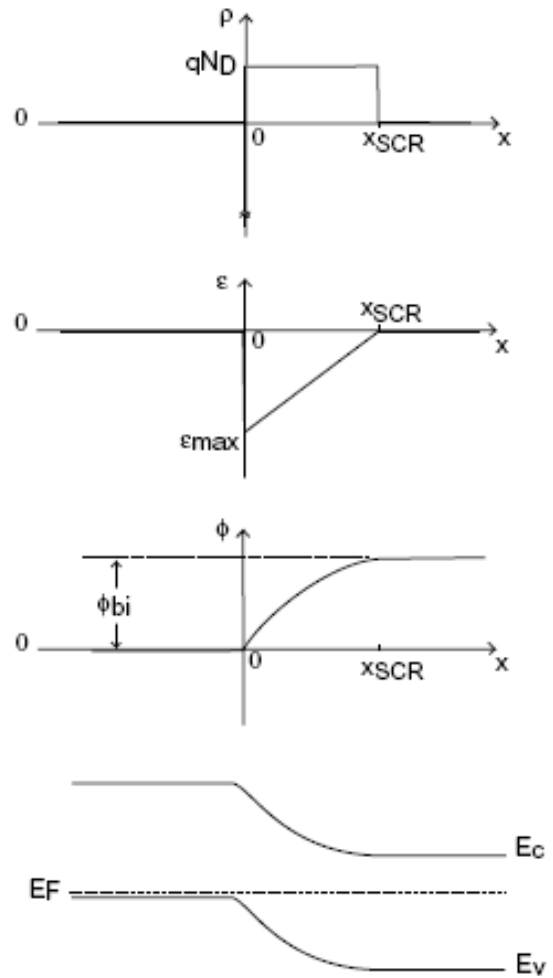
- 强非对称结: 也就是 $p^+ - n$ 结 $N_A \gg N_D$

$$x_p = x_n; x_{SCR}; \sqrt{\frac{2 \phi_{bi}}{qN_D}}$$

$$|\mathcal{E}_{max}|; \sqrt{2qN_D \phi_{bi}}$$

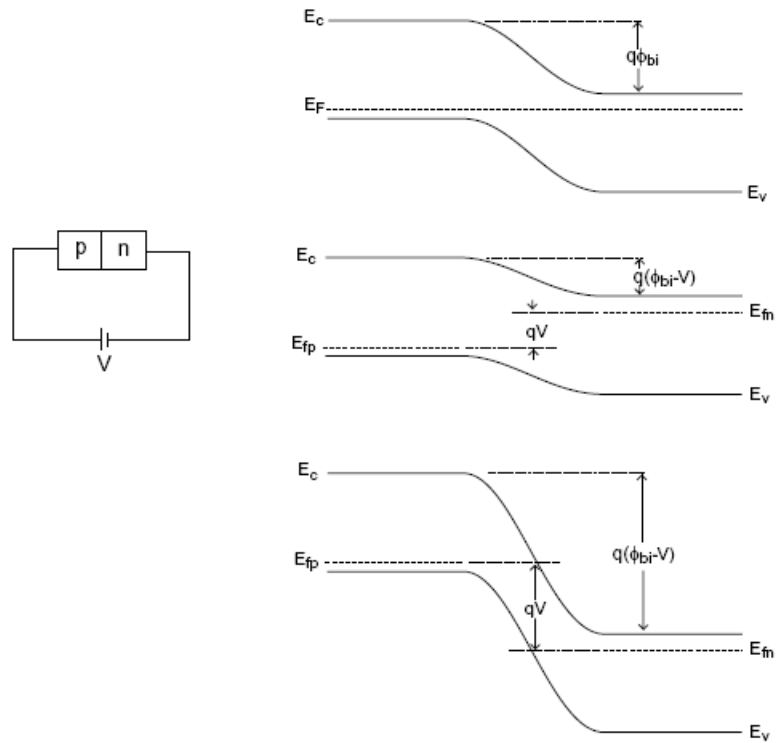
都由底掺杂一侧决定

$$\left| \phi(-x_p) \right| = \phi(x_n); \phi_{bi}$$



2. 理想的p-n结在非平衡时

□ 静电态:



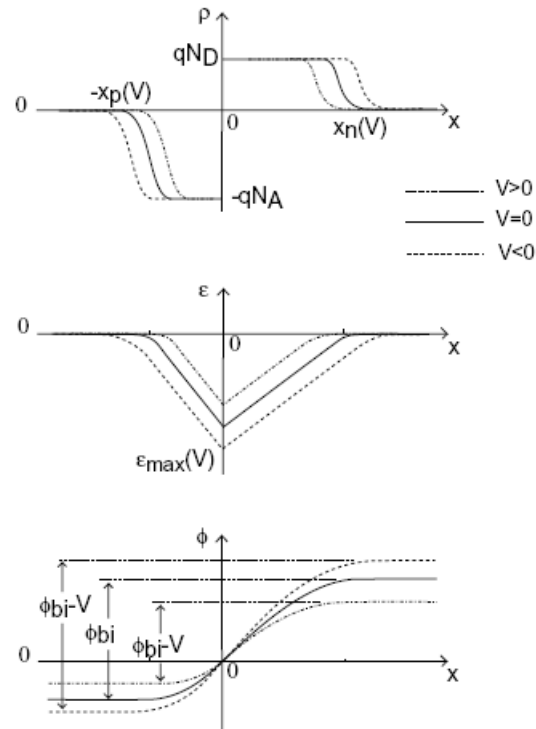
在正向和反向:

$$\phi_{bi} \quad \phi_{bi} \quad V$$

定量地讲，静电态没有变化到平衡之外→使用平衡方程：

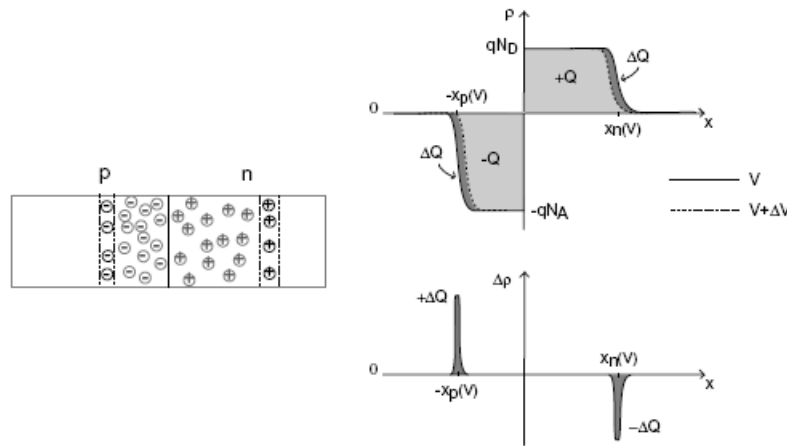
$$x_{SCR}(V) = \sqrt{\frac{2 - (N_D - N_A)(\phi_{bi} - V)}{qN_A N_D}} = x_{SCR}(V = 0) \sqrt{1 - \frac{V}{\phi_{bi}}}$$

$$|\epsilon_{\max}(V)| = \sqrt{\frac{2qN_A N_D(\phi_{bi} - V)}{(N_D - N_A)}} = |\epsilon_{\max}(V = 0)| \sqrt{1 - \frac{V}{\phi_{bi}}}$$



□ 耗尽电容:

换一种方法考虑:



$$C(V) = \frac{\epsilon}{x_{SCR}(V)}$$

那么:

$$C(V) = \sqrt{\frac{\epsilon q N_A N_D}{2(N_D + N_A)(\phi_{bi} - V)}} = \frac{C(V = 0)}{\sqrt{1 - \frac{V}{\phi_{bi}}}}$$

$$C(V) = \sqrt{\frac{\epsilon q N_A N_D}{2(N_D + N_A)(\phi_{bi} - V)}} = \frac{C(V=0)}{\sqrt{1 - \frac{V}{\phi_{bi}}}}$$

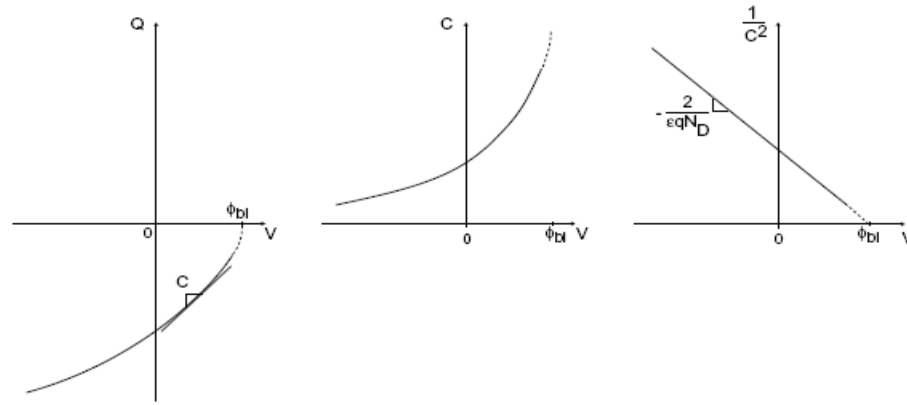
对 $p^+ - n$ 结:

$$C(V) = \sqrt{\frac{\epsilon q N_D}{2(\phi_{bi} - V)}}$$

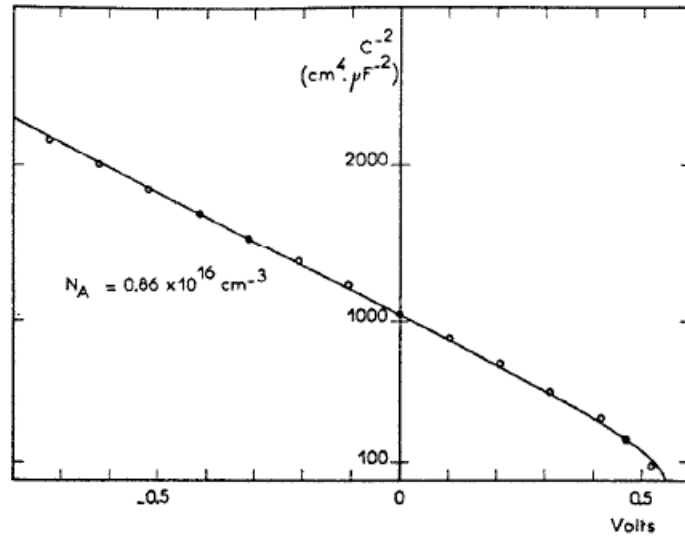
电容由低掺杂一侧决定

提取 ϕ_{bi} 和 N_{low} 的技术:

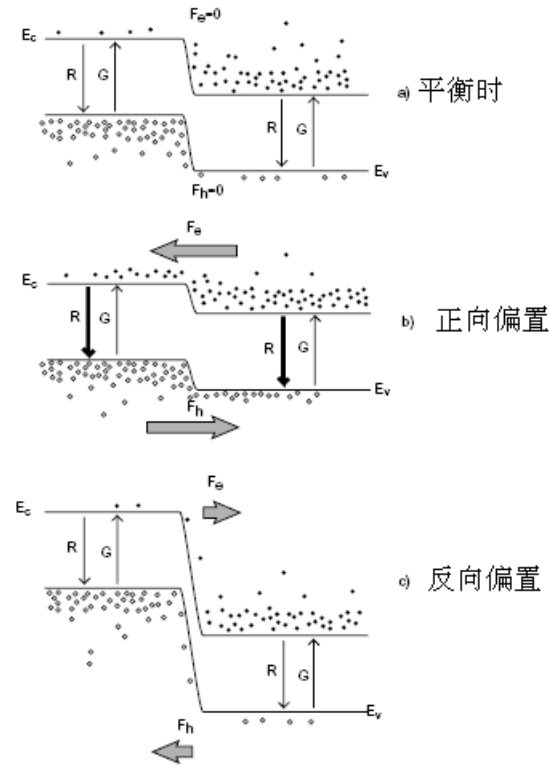
$$\frac{1}{C^2} = \frac{2(\phi_{bi} - V)}{\epsilon q N_D}$$



试验验证:



□ I-V特性:



在TE时:

- 通过SCR的电子和空穴流是平衡的
- 在QNR's时G和R是平衡的
- $I=0$

* 在正向偏置:

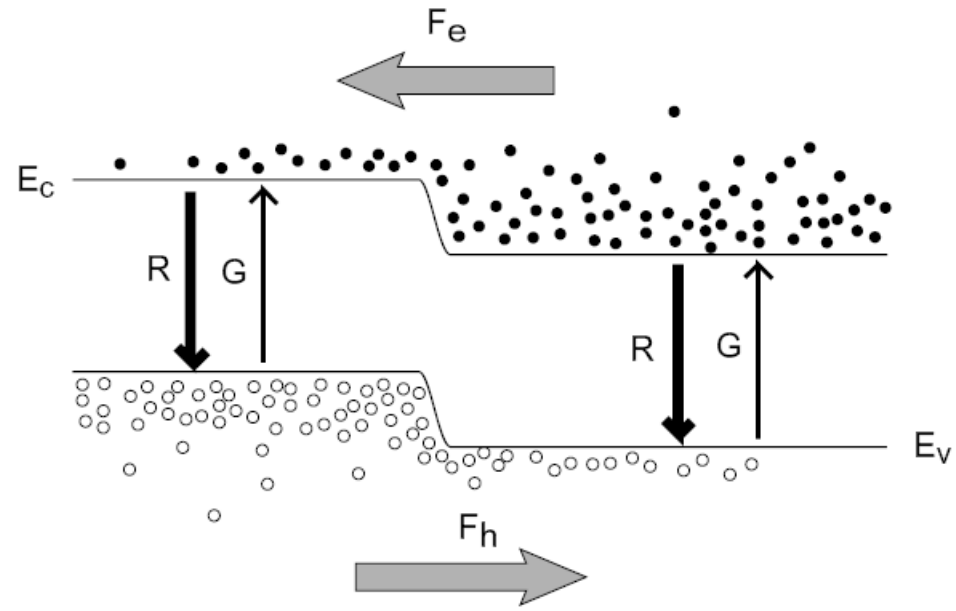
- 少数载流子的势垒能量减小
- 少数载流子注入
- 在QNR's时 $R>G$
- $I: e^{qV/kT}$

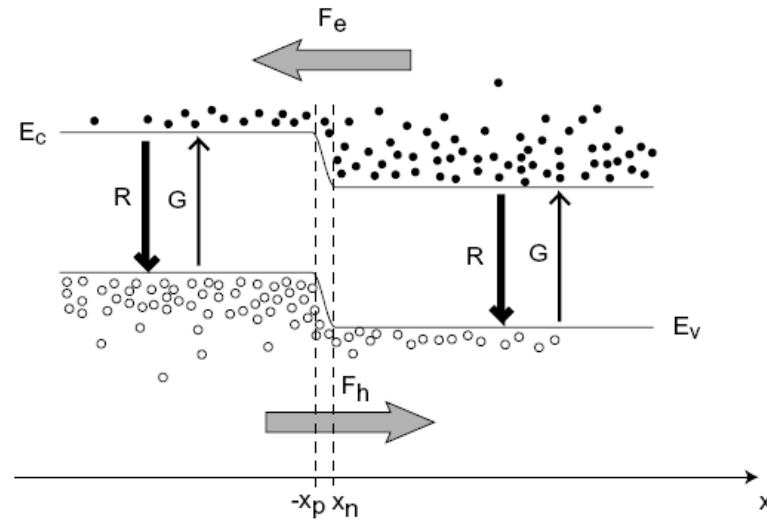
* 在反向偏置:

- 少数载流子的势垒能量增加
- 少数载流子抽取
- 在QNR's时 $G>R$
- I饱和到一个极小值

对I—V特性主要考虑的构造模型:

- 结电压要设置的使载流子浓度具有足够的被注入的能量;
- 载流子注入率由少数载流子传输和准中性区G/R率来设置;
- SCR是在准中性态。





推导一阶I—V特性模型的方法：

- 计算二极管的电流密度如下：
$$J = J_e(-x_p) + J_h(x_n)$$
- 计算每种载流子对电流的贡献：
$$J_e(-x_p) = -qn'(-x_p)v_e(-x_p)$$
$$J_h(x_n) = -qp'(x_n)v_h(x_n)$$
- 用表达式 $v_e(-x_p)$ 和 $v_h(x_n)$ 推导在Ch. 5中类似的少数载流子问题。
- 推导 $n'(-x_p)$ 和 $p'(x_n)$ 的表达式，假定在空间电荷区处于准平衡态。

- 对正向和反向结果是一致的。

主要结论

- P-N结的内建势：

$$\phi_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

- 耗尽近似：两个准中性区被在TE时要求详细的平衡，即各处 $J_e = J_h = 0$ 。一个空间电荷区分开。
- 在强非对称结静电态的特性由低掺杂水平区域决定；也就是说，对 $p^+ - n$ 结：

$$x_{SCR} ; \sqrt{\frac{2 \phi_{bi}}{q N_D}} \quad |\epsilon_{\max}| ; \sqrt{2 q N_D \phi_{bi}}$$

- 平衡之外的静电态和在TE时一样，只要 $\phi_{bi} \ll V$ 。
- 由于SCR宽度调整的耗尽层电容：

$$C(V) = \frac{1}{x_{SCR}(V)}$$

- 正向偏压：结势垒 \downarrow 载流子注入 在QNR's时复合 $I : e^{qV/kT}$ 。

- 反向偏压：结势垒 \uparrow 载流子抽取 在QNR's时产生 在反向V时I饱和